

RÄTTELSER

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1922 av den 10 oktober 2018 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

(Europeiska unionens officiella tidning L 319 av den 14 december 2018)

På sidan 129, under avsnitt 3B001 f, har uppställningen av punkterna 3 och 4 rättats.

I stället för: "3. Utrustning som är speciellt konstruerad för att tillverka masker och som har allt av följande:

- a) Den använder avlänkade fokuserade elektron-, jon- eller "laser"strålar, och
- b) har något av följande:
 1. En halvvärdesbredd på under 65 nm och bildplacering på mindre 17 nm (medelvärde + 3 sigma).
 2. Används inte.
 3. Misspass på andra lagret på mindre än 23 nm (medelvärde + 3 sigma) på masken.
 4. Utrustning som är konstruerad för bearbetning med hjälp av direkta skrivmetoder och som har allt av följande:
 - a) Den använder avlänkade fokuserade elektronstrålar, och
 - b) har något av följande:
 1. En minsta strålstorlek på högst 15 nm.
 2. Misspass på mindre än 27 nm (medelvärde + 3 sigma)."

ska det stå: "3. Utrustning som är speciellt konstruerad för att tillverka masker och som har allt av följande:

- a) Den använder avlänkade fokuserade elektron-, jon- eller "laser"strålar, och
- b) har något av följande:
 1. En halvvärdesbredd på under 65 nm och bildplacering på mindre 17 nm (medelvärde + 3 sigma).
 2. Används inte.
 3. Misspass på andra lagret på mindre än 23 nm (medelvärde + 3 sigma) på masken.
4. Utrustning som är konstruerad för bearbetning med hjälp av direkta skrivmetoder och som har allt av följande:
 - a) Den använder avlänkade fokuserade elektronstrålar, och
 - b) har något av följande:
 1. En minsta strålstorlek på högst 15 nm.
 2. Misspass på mindre än 27 nm (medelvärde + 3 sigma)."